実験報告書様式(一般利用課題·成果公開利用)

MIE Exportmontal Poport	提出日 Date of Report	
J-PARC WILL Experimental Report	2011. 1. 18	
課題番号 Project No.	装置責任者 Name of responsible person	
2010A0022	山田悟史	
実験課題名 Title of experiment	装置名 Name of Instrument/(BL No.)	
ナフィオン/ プラチナ界面の構造解析	ARISA-II	
実験責任者名 Name of principal investigator	実施日 Date of Experiment	
原田雅史	2010. 11. 16 - 2010. 11. 19	
所属 Affiliation		
株式会社豊田中央研究所		

試料、実験方法、利用の結果得られた主なデータ、考察、結論等を、記述して下さい。(適宜、図表添付のこと) Please report your samples, experimental method and results, discussion and conclusions. Please add figures and tables for better explanation.

1. 試料 Name of sample(s) and chemical formula, or compositions including physical form.

試料は、①プラチナをスパッタしたシリコン
基板にスピンコートしたナフィオン薄膜である.
比較のため、②スパッタしない基板上の薄膜、
③高濃度の溶液からスピンコートした薄膜、
④組成が異なる溶液からスピンコートした薄膜
も作製した.以上、右表にまとめて示す.

	基板	溶液の濃度	溶媒の組成
1	Pt スパッタ	- 0.5wt%	
2	Si		イソフ゜ロハ゜ノール
3	Pt スパッタ	2.5wt%	_
4		0.5wt%	イソフ゜ロハ゜ノール/水

2. 実験方法及び結果(実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。)

Experimental method and results. If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons.

各種試料について、湿度を変えて中性子反射率を測定した. 湿度は、密閉セルに KCI 飽和水溶液または シリカゲルを同封し、数時間静置することによって制御した. コントラストを変えるため、水溶液の水は重水ま たは軽水とした. 中性子反射率は 0.3°, 0.75°, 2°, 5.5°(3.5°)で入射したパルス中性子の強度を TOF の二次元ディテクタで測定して評価した.

各角度で求めた中性子反射率はバックグラウンドを補正した後,全反射強度が1となるようにスケールし, 滑らかにつながるようにシフトさせた. q は 0.008 Å⁻¹ から 0.38 Å⁻¹(0.28 Å⁻¹),反射率は 10⁻⁷程度までのスペ クトルが得られた.

各試料の中性子反射率スペクトルは、スパッタした Pt と Si 基板の構造を各湿度で共通のパラメータとして、 グローバルフィットした. 湿度と水のコントラストの影響は、 ナフィオン薄膜の散乱長密度、 厚さ、 ラフネスに 反映される. ここでは、 ナフィオン薄膜の平均的な構造について考察するため、 フィッティング区間を q<0.15Å⁻¹に限定して解析した.

2. 実験方法及び結果(つづき) Experimental method and results (continued)

①Ptをスパッタした Si 基板上のナフィオン薄膜, ②スパッタしない Si 基板上の薄膜, ③高濃度の溶液から スピンコートした薄膜, ④組成が異なる溶媒を用いた薄膜の結果を図 1 に示す. 高湿度の場合が赤線(重水) と青線(軽水), 低湿度の場合が黒線である. いずれも, ナフィオンの構造において, 湿度による変化および重 水と軽水のコントラストの差が観察された. スパッタした Pt の厚さは 1200Å程度, ナフィオン薄膜の厚さは約 120Å(高濃度の溶液の場合は約 600Å)であった.

高湿度と低湿度の薄膜の散乱長密度プロファイルを比較すると、湿度の増加に伴って膜厚が増加する傾向が見られた.重水と軽水の場合の散乱長密度の差からナフィオン薄膜中の水の密度を求め、ナフィオン分子の密度をバルクの場合と比較することができる.



図1 各種ナフィオン薄膜の中性子反射率スペクトルと散乱長密度プロファイル. 高湿の場合:赤線(重水)と青線(軽水),低湿の場合:黒線. (a)は①Ptをスパッタした Si 基板上のナフィオン薄膜. (b)は②Pt をスパッタしない基板上の薄膜. (c)は③高濃度の溶液をスピンコートした薄膜. (d)は④組成の異なる溶媒でスピンコートした薄膜.